

Aka-Brief #2 陶瓷电容器 (MLCC)

1



Rhaco Grit
P800



水



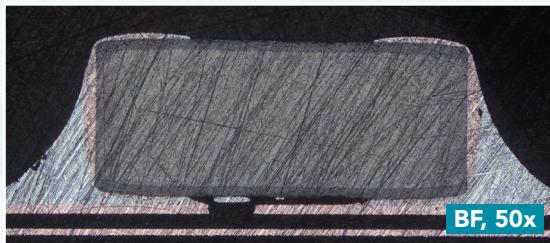
300 RPM



25 N



磨平



2



Lagan 9



DiaUltra
6 μm



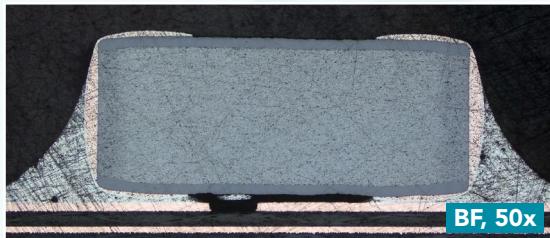
150 RPM



30 N



3 min



3



Daran



DiaUltra
1 μm



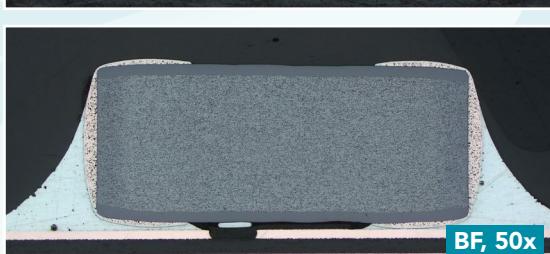
150 RPM



25 N



3 min



4



Chemal*



Colloidal
Silica 50 nm
Alkaline



150 RPM



15 N



2 min



图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

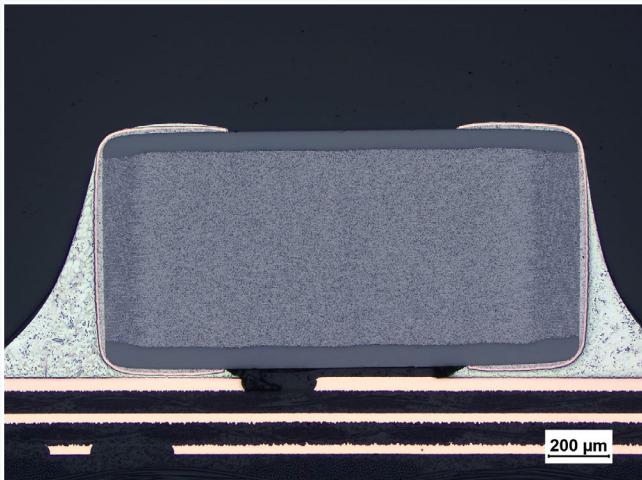
样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

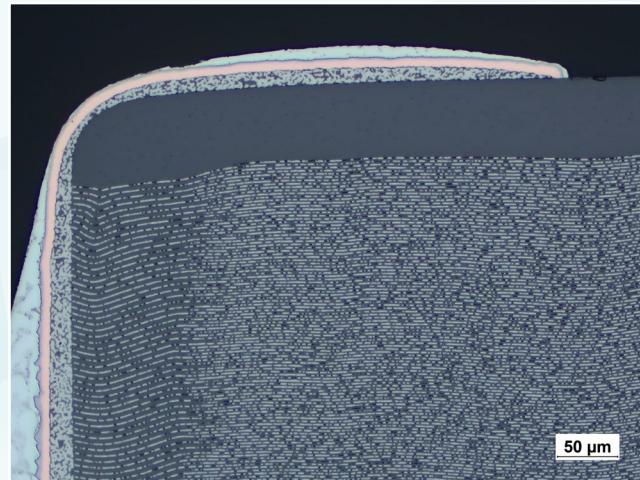


Aka-Brief #2 陶瓷电容器 (MLCC)

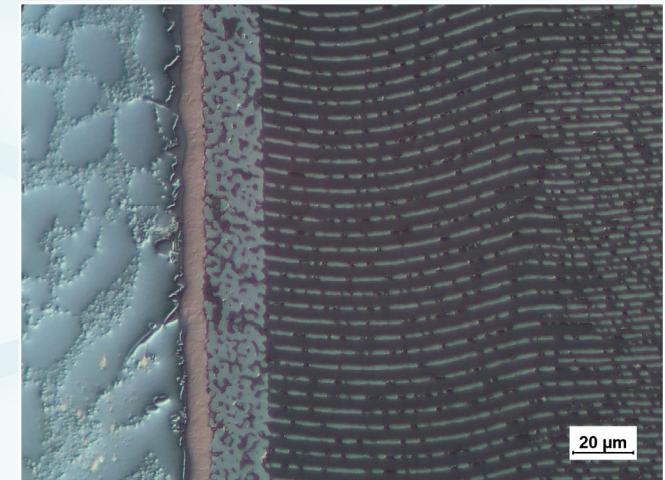
最终制样结果



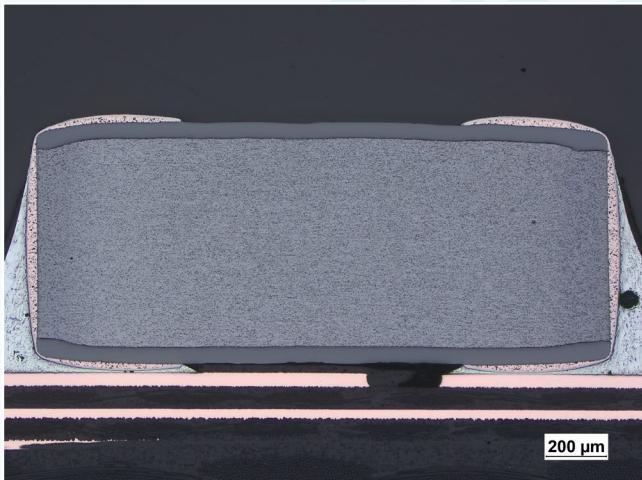
MLCC, 样品1, 明场像, 50倍



MLCC, 样品1, 明场像, 200倍



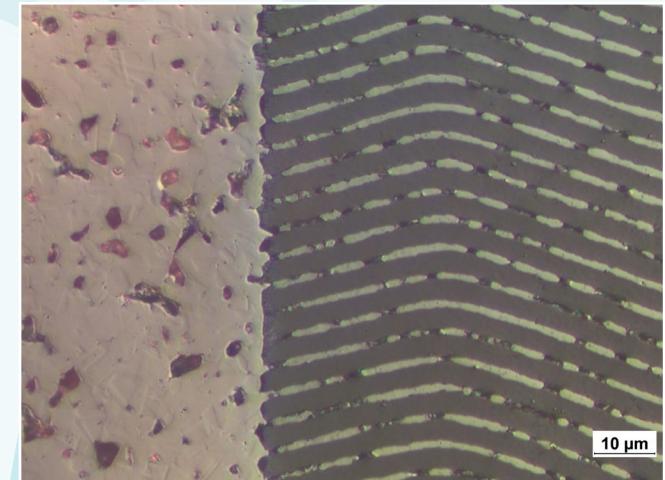
MLCC, 样品1, 微分干涉衬度像, 500倍



MLCC, 样品2, 明场像, 50倍



MLCC, 样品2, 微分干涉衬度像, 200倍



MLCC, 样品2, 微分干涉衬度像, 1000倍